Docket No. 246940US2/ims





IN THE UNITED STATE D TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Yoshiyuki NAGATOMO, et al.

GAU:

2811

SERIAL NO: 10/743,081

EXAMINER:

FILED:

December 23, 2003

FOR:

HEAT-CONDUCTING MULTILAYER SUBSTRATE AND POWER MODULE SUBSTRATE

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONED FOR DATENTS

ALEXANDRIA, VIRGINIA 223											
SIR:											
☐ Full benefit of the filing date of provisions of 35 U.S.C. §120.	f U.S. Application Serial Number	, filed , is claimed pursuant t	o the								
☐ Full benefit of the filing date(s §119(e):	e) of U.S. Provisional Application(s) is <u>Application No.</u>	s claimed pursuant to the provisions o <u>Date Filed</u>	f 35 U.S.C								
Applicants claim any right to the provisions of 35 U.S.C. §1		ions to which they may be entitled pur	suant to								
In the matter of the above-identific	ed application for patent, notice is here	eby given that the applicants claim as	priority:								
COUNTRY JAPAN	APPLICATION NUMBER 2002-380401	MONTH/DAY/YEAR December 27, 2002									
JAPAN	2003-397839	November 27, 2003									
Certified copies of the correspond are submitted herewith will be submitted prior to pure filed in prior applicate were filed in prior applicate to the Interest of the Int	payment of the Final Fee	Jumber									
Receipt of the certified cop		mely manner under PCT Rule 17.1(a)	has been								
☐ (A) Application Serial No.	(s) were filed in prior application Seri	al No. filed ; and									
☐ (B) Application Serial No.	(s)										
☐ are submitted herew	ith										
☐ will be submitted pr	ior to payment of the Final Fee										
	Respectfully Submitted,										
		DBLON, SPIVAK, McCLELLAND,									

Customer Number

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03)

Registration No. 24,913

Joseph A. Scafetta, Jr. Registration No. 26,803

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年12月27日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-380401

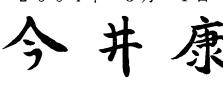
[ST. 10/C]:

[J P 2 0 0 2 - 3 8 0 4 0 1]

出 願 人
Applicant(s):

三菱マテリアル株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 3月 1日





【書類名】

特許願

【整理番号】

J97166A1

【提出日】

平成14年12月27日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H01L 23/34

【発明の名称】

パワーモジュール用基板

【請求項の数】

3

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県那珂郡那珂町向山1002-14 三菱マテリア

ル株式会社 総合研究所那珂研究センター内

【氏名】

長友 義幸

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県さいたま市北袋町1丁目297番地 三菱マテリ

アル株式会社 総合研究所内

【氏名】

根岸 健

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県那珂郡那珂町向山1002-14 三菱マテリア

ル株式会社 総合研究所那珂研究センター内

【氏名】

長瀬 敏之

【特許出願人】

【識別番号】

000006264

【氏名又は名称】

三菱マテリアル株式会社

【代理人】

【識別番号】

100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】

志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】

100108578

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 詔男

【選任した代理人】

【識別番号】

100101465

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100117189

【弁理士】

【氏名又は名称】 江口 昭彦

【選任した代理人】

【識別番号】

100120396

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉浦 秀幸

【選任した代理人】

【識別番号】

100108453

【弁理士】

【氏名又は名称】 村山 靖彦

【選任した代理人】

【識別番号】

100106057

【弁理士】

【氏名又は名称】 柳井一則子

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

008707

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0205685

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 パワーモジュール用基板

【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁基板と、該絶縁基板の一方の面に積層される回路層と、該絶縁基板の他方の面に積層される金属層と、前記回路層にはんだを介して搭載される半導体チップと、前記金属層に接合される放熱体とを備えたパワーモジュール用基板であって、前記回路層及び金属層を、純度が99. 999%以上の銅で構成したことを特徴とするパワーモジュール用基板。

【請求項2】 請求項1に記載のパワーモジュール用基板であって、前記放 熱体は、はんだ、ろう付け又は拡散接合によって前記金属層に接合されていることを特徴とするパワーモジュール用基板。

【請求項3】 請求項1又は2に記載のパワーモジュール用基板であって、前記絶縁基板は、AlN、Al2O3、Si3N4又はSiCからなることを特徴とするパワーモジュール用基板。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

この発明は、大電圧、大電流を制御する半導体装置に用いられるパワーモジュール用基板に関し、特に、半導体チップから発生する熱を放散させる放熱体を備えたパワーモジュール用基板に関するものである。

 $[0\ 0\ 0\ 2\]$

【従来の技術】

従来、この種のパワーモジュール用基板として、図2に示すように、AINからなる絶縁基板12の一方の面にAI又はCuからなる回路層13を積層し、他方の面にAI又はCuからなる金属層14を積層し、回路層13にはんだ17を介して半導体チップ15を搭載し、金属層14にはんだ18、ろう付け等により放熱体16を接合したパワーモジュール用基板11や、図3に示すように、AINからなる絶縁基板22の一方の面に4N-AI(純度が99.99%以上のアルミニウム)からなる回路層23を積層し、他方の面に4N-AIからなる金属

層24を積層し、回路層23にはんだ27を介して半導体チップ25を搭載し、 金属層24にはんだ28、ろう付け等により放熱体26を接合したパワーモジュ ール用基板21等が知られている。このようなパワーモジュール用基板は、各種 提供されている(例えば、特許文献1参照。)。

[0003]

上記のパワーモジュール用基板11、21にあっては、放熱体16、26を例えば冷却シンク部(図示せず)に取り付け、放熱体16、26に伝達される半導体チップ15、25からの熱を冷却シンク部内の冷却水(又は冷却空気)を介して外部に放出させている。

[0004]

【特許文献1】

特公平4-12554号公報(第1-3頁、第1図、第2図)

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上記のような構成のパワーモジュール用基板11、21にあっては、回路層13、23及び金属層14、24をCuで構成した場合には、一40~125℃の温度サイクルを繰り返し作用させた場合に、数10~100サイクル程度で回路層13、23と半導体チップ15、25との間のはんだ17、27にクラックが生じ、500サイクル程度で回路層13、23が絶縁基板12、22から剥離してしまうが、回路層13、23及び金属層14、24をA1で構成した場合には、3000サイクル程度まで回路層13、23と半導体チップ15、25との間のはんだ17、27にクラックが生じることはない。このことは、温度サイクルを繰り返し作用させた場合に、回路層13、23及び金属層14、24をA1で構成した場合には内部応力が蓄積しないのに対し、Cuで構成した場合には内部応力が蓄積しないように構成すれば良いことになる。

[0006]

一方、A 1 と C u との熱伝導率を比較すると、 C u の方が A 1 よりも良いので、半導体チップ 1 5 、 2 5 からの熱を効率良く放熱体 1 6 、 2 6 側に伝達させて

放出させるためには、熱伝導率の良いCuで回路層13、23及び金属層14、24を構成した方が良いが、Cuの場合には、前述したような内部応力の蓄積の問題があるので、温度サイクルに対する長寿命と良好な熱伝達率との両方を満足させることは困難であり、何れかを犠牲にしなければならなかった。

[0007]

本発明は、上記のような従来の問題に鑑みなされたものであって、温度サイクルに対する寿命を延ばすことができるとともに、良好な熱伝達率が得られて半導体チップからの熱を効率良く放熱体側に伝達させて放出させることができるパワーモジュール用基板を提供することを目的とするものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明は、上記のような課題を解決するために、以下のような手段を採用している。すなわち、請求項1に係る発明は、絶縁基板と、該絶縁基板の一方の面に積層される回路層と、該絶縁基板の他方の面に積層される金属層と、前記回路層にはんだを介して搭載される半導体チップと、前記金属層に接合される放熱体とを備えたパワーモジュール用基板であって、前記回路層及び金属層を、純度が99.999%以上の銅で構成したことを特徴とする。

この発明によるパワーモジュール用基板によれば、回路層及び金属層は、純度が99.99%以上の銅で構成されるので、温度サイクルが繰り返し作用した場合に、再結晶により内部応力が消滅することになる。従って、内部応力が蓄積することがないので、温度サイクル寿命を延ばすことができる。また、回路層及び金属層は銅から構成されているので熱伝導率を良くすることができる。従って、半導体チップからの熱を効率良く放熱体側に伝達させて放出させることが可能となる。

[0009]

請求項2に係る発明は、請求項1に記載のパワーモジュール用基板であって、 前記放熱体は、はんだ、ろう付け又は拡散接合によって前記金属層に接合されて いることを特徴とする。

この発明によるパワーモジュール用基板によれば、回路層及び金属層は、純度

が99.999%以上の銅で構成されるので、温度サイクルが繰り返し作用した場合に、再結晶により内部応力が消滅することになる。従って、内部応力が蓄積することがないので、温度サイクル寿命を延ばすことができる。また、回路層及び金属層は銅から構成されているので熱伝導率を良くすることができる。従って、半導体チップからの熱を銅からなる回路層、絶縁基板、及び銅からなる金属層を介して放熱体側に効率良く伝達させて放出させることが可能となる。

[0010]

請求項3に係る発明は、請求項1又は2に記載のパワーモジュール用基板であって、前記絶縁基板は、AIN、AI2O3、Si3N4又はSiCからなることを特徴とする。

この発明によるパワーモジュール用基板によれば、回路層及び金属層は、純度が99.999%以上の銅で構成されるので、温度サイクルが繰り返し作用した場合に、再結晶により内部応力が消滅することになる。従って、内部応力が蓄積することがないので温度サイクル寿命を延ばすことができる。また、回路層及び金属層は銅から構成されているので熱伝導率を良くすることができる。従って、半導体チップからの熱を、銅からなる回路層、AIN、A12O3、Si3N4又はSiCからなる絶縁基板、及び銅からなる金属層を介して放熱体側に効率良く伝達させて放出させることが可能となる。

[0011]

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。

図1には、本発明によるパワーモジュール用基板の一実施の形態が示されていて、このパワーモジュール用基板1は、絶縁基板2と、絶縁基板2の一方の面に積層される回路層3と、絶縁基板2の他方の面に積層される金属層4と、回路層3に搭載される半導体チップ5と、金属層4に接合される放熱体6とを備えている。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

絶縁基板2は、例えばAIN、AI2O3、Si3N4、SiC等により所望の大きさに形成されるものであって、その上面及び下面に回路層3及び金属層4がそ

れぞれ積層接着されるようになっている。

$[0\ 0\ 1\ 3]$

回路層 3 及び金属層 4 を絶縁基板 2 に積層接着する方法としては、絶縁基板 2 と回路層 3 及び金属層 4 とを重ねた状態で、これらに荷重 0. $5 \sim 2$ k g f / c m 2 (4. 9×1 0 $4 \sim 1$ 9. 6×1 0 4 P a) を加え、N2雰囲気中で 1 0 6 5 $\mathbb C$ に加熱するいわゆる DB C法(Direct Bonding Copper法)、絶縁基板 3 と回路層 3 及び金属層 4 との間にAg - Cu - Ti - 3 う材の箔を挟んだ状態で、これらに荷重 0. $5 \sim 2$ k g f / c m 2 (4. 9×1 0 $4 \sim 1$ 9. 6×1 0 4 P a)を加え、真空中で 8 0 $0 \sim 9$ 0 0 0 に加熱するいわゆる活性金属法等があり、用途に応じて適宜の方法を選択して使用すれば良い。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

[0015]

[0016]

回路層3には、半導体チップ5を搭載するための回路パターンが形成され、この回路層3の上部にはんだ7を介して半導体チップ5が搭載されている。金属層3の下面には、はんだ8、ろう付け、拡散接合等によって放熱体6が一体に接合されている。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

放熱体6は、例えば、A1、Cu等のような高熱伝導材(熱伝導率の良好な素材)からなる放熱体本体と、高炭素鋼(Fe-C)等のような低熱膨張材とを複数接合させて多層構造に形成したものであって、下方に位置する冷却シンク部9に取り付けられて使用され、冷却シンク部9内の冷却水(又は冷却空気)を介して放熱体6に伝達される半導体チップ5からの熱を外部に放出させる。

[0018]

上記のように構成したこの実施の形態によるパワーモジュール用基板1にあっては、回路層3及び金属層4を純度99.999%以上のCu(5N-Cu)で構成しているので、-40~125℃の温度サイクルが繰り返し作用する条件下で使用しても、内部応力が蓄積するようなことはなく、温度サイクルの高温側での加工硬化を抑制することができる。従って、SiC、GaN等のように、高温領域で作動するデバイスでの使用が可能となる。

[0019]

[0020]

表1に、従来のパワーモジュール用基板と本発明のパワーモジュール用基板との温度サイクル寿命を比較した結果を示す。ここで、セラミックスは絶縁基板を示し、金属回路は回路層及び金属層を示し、OFCは無酸素銅(Cu;99.9~99.99%)を示している。この表1から、本発明によるパワーモジュール用基板が従来のパワーモジュール用基板よりも温度サイクル寿命が長いことが分かる。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

【表1】

温度サイクル寿命		520	5200	3100	1320	510	2900	2800	7200	8100	5200	5210	6200	5800	4800	3520	8250	5630	7520
	材質	OFC	Al	Al	0FC	OFC	A1	OFC	Al	A1	no-N9	N-Cu	eN-Cu	ON-Cu	PN-Cu	ON-Cu	N-Cu	N9-Cu	6N-Cu
金属回路	厚さ(mm)	0.3	0.4	9.0	0.3	0.3	0.4	0.3	9.0	0.4	0.3	0.4	9.0	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.4
	寸法(mm)	28×28	38×48	28×13	48×48	68×33	58×33	28×28	28×18	48×38	28×28	38×48	28×13	48×48	68×33	58×33	28×28	28×18	48×38
7	材質	AIN	AIN	AIN	A1203	A1203	A1203	Si3N4	Si3N4	Si3N4	AlN	AIN	AIN	A1203	A1203	A1203	Si3N4	Si3N4	Si3N4
セラミックス	厚さ(mm)	0.635	0.635	0.635	0,635	0.32	0.32	0.635	0.32	0.32	0.635	0.635	0.635	0.635	0.32	0.32	0.635	0.32	0.32
	寸法(mm) 厚さ(mm)	30×30	40×50	30×15	50×50	70×35	60×35	30×30	30×20	50×40	30×30	40×50	30×15	50×50	70×35	60×35	30×30	30×20	50×40
					符	*	<u>e</u>			•				Ж	雷	명			

[0022]

【発明の効果】

以上、説明したように、本発明のパワーモジュール用基板によれば、回路層及び金属層は、純度が99.999%以上の銅で構成されることになるので、温度サイクルが繰り返し作用した場合に、再結晶により内部応力が消滅することにな

る。従って、内部応力が蓄積することがないので、温度サイクル寿命を著しく延ばすことができることになる。また、回路層及び金属層は、熱伝導率の良好な銅から構成されることになるので、半導体チップからの熱を効率良く放熱体側に伝達させて放出させることができることになる。従って、温度サイクルに対する長寿命と良好な熱伝導率との両方を満足させることができるパワーモジュール用基板を提供することができることになる。

【図面の簡単な説明】

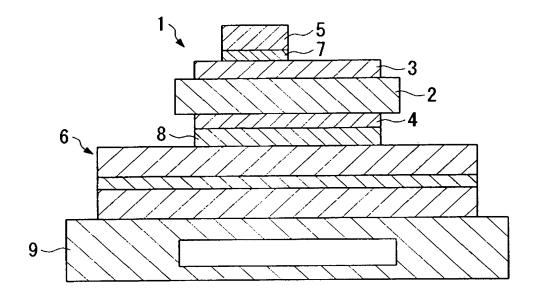
- 【図1】 本発明によるパワーモジュール用基板の一実施の形態を示した概略断面図である。
 - 【図2】 従来のパワーモジュール用基板の一例を示した概略断面図である
 - 【図3】 従来のパワーモジュール用基板の他例を示した概略断面図である

【符号の説明】

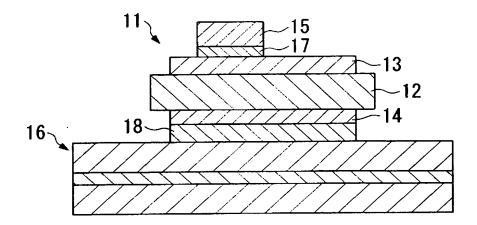
- 1 パワーモジュール用基板
- 2 絶縁基板
- 3 回路層
- 4 金属層
- 5 半導体チップ
- 6 放熱体
- 7 はんだ



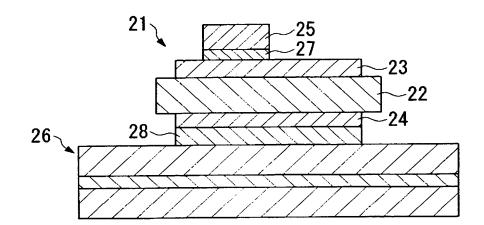
図1】



【図2】



【図3】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 温度サイクルに対する長寿命と良好な熱伝達率の両方を満たすことができるパワーモジュール用基板を提供する。

【解決手段】 絶縁基板2と、絶縁基板2の一方の面に積層される回路層3と、 絶縁基板3の他方の面に積層される金属層4と、回路層3にはんだ7を介して搭 載される半導体チップ5と、金属層4に接合される放熱体6とを備える。回路層 3及び金属層4は、純度が99.999%以上の銅で構成される。温度サイクル が繰り返し作用しても、内部応力が蓄積することはなく、温度サイクル寿命を延 ばすことができる。また、回路層3及び金属層4は、熱伝導率の良好な銅から構 成されるので、半導体チップ5からの熱を効率良く放熱体6側に伝達させて放出 させることができる。

【選択図】 図1



特願2002-380401

出願人履歴情報

識別番号

[000006264]

1. 変更年月日

1992年 4月10日

[変更理由]

住所変更

住所

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

氏 名

三菱マテリアル株式会社